

Id Apogée	Libelle	NEL	PEL	NbH CM	NbH TD	NbH TP	Min choix	Max choix	ECTS	Code CNU	Session 1	Coeff	Durée	Session 2	Coeff	Durée
129BC01	Nanophysique et Modélisation	BCC	S3						11							
129UD01	Physique du solide et des surfaces	UE	S9	10	10				2	28						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	50%	2H	Ecrit E2	100%	2h
	Contrôle continu	EPR									CC2 C2	50%	2H			
129UD09	Modélisation numérique des Nanomatériaux (ab-initio, DFT,)	UE	S9	10		20			3	28						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	33,33%	2H	Ecrit E2	33,33%	2h
	Travaux Pratiques	EPR									TP P1	33,33%	2H			
	Travaux Pratiques	EPR									TP P2	33,33%	2H	Report de note session 1		
129UD13	Nanophysique et nanomagnétisme	UE	S9	20	20				4	28						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	50%	2H	Ecrit E2	100%	2h
	Contrôle continu	EPR									CC2 C2	50%	2H			
129UD15	Transport électronique et théorie moderne de la polarisation	UE	S9	10	10				2	28						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	50%	2H	Ecrit E2	100%	2h
	Contrôle continu	EPR									CC2 C2	50%	2H			
129BC02	Techniques innovantes en optique et diffraction	BCC	S3						11							
129UD03	Techniques avancées de diffraction et diffusion	UE	S9	10	10	8			3	28						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	30%	2H	Ecrit E2	60%	2h
	Contrôle continu	EPR									CC2 C2	30%	2H			
	Travaux Pratiques	EPR									TP P2	40%	2H	Report de note session 1		
129UD10	Nanophotonique	UE	S9	20					2	28						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	66,67%	2H	Ecrit E2	66,67%	2h
	Oral	EPR									Oral O1	33,33%	30min			
129UD16	Physique ultrarapide	UE	S9	10	5	5			2	28						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	33,33%	2H	Ecrit E2	66,67%	2h
	Contrôle continu	EPR									CC2 C2	33,33%	2H			
	Travaux Pratiques	EPR									TP P2	33,33%	2H	Report de note session 1		
519EN007	Capteurs et mesures holographiques	UE	S9	20		16			4	63						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	66,67%	2H	Ecrit E2	66,67%	2h
	Travaux pratiques	EPR									TP P1	33,33%	2H			
129BC03	Instrumentation et procédés de fabrication	BCC	S3						8							
129UD04	Microtechnologies - Microsystèmes	UE	S9	12		6			2	63						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	60%	2H	Ecrit E2	60%	2h
	Travaux pratiques	EPR									TP P1	40%	2H			
139UD05	Microscopies	UE	S9	20	4				3	33						
	Electronique : Contrôle continu	EPR									CC1 C1	50%	2H	Ecrit E2	100%	2h
	Champ proche : Contrôle continu	EPR									CC2 C2	50%	2H			
539EN006	Mesure et instrumentation avancée	UE	S9	5	10	12			3	30						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	60%	2H	Ecrit E2	60%	2h
	Travaux pratiques	EPR									TP P1	40%	2H			

Id Apogée	Libelle	NEL	PEL	NbH CM	NbH TD	NbH TP	Min choix	Max choix	ECTS	Code CNU	Session 1	Coeff	Durée	Session 2	Coeff	Durée
129BC05	Pratiques socio-professionnelles et stage	BCC	S3						27							
120UP01	Stage	UE	S0						23	0						
	Soutenance	EPR									Soutenance	100%		Pas de seconde session		
129UL01	Anglais	UE	S9		20				3	11NS						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	100%	2H	Ecrit E2	100,00%	2H
509EN009	Gestion de l'innovation	UE	S9	11,3	6,25				1	6						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	100%	2H	Pas de seconde session		
129BC04	UE optionnelle	CHOI	S3						3							
129UD14	Plasmonique et applications	UE	S9	10	10				3	28						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	100%	2H	Ecrit E2	100,00%	2H
129UD17	Physique de la matière molle	UE	S9	10	10				3	28						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	50%	2H	Ecrit E2	100%	2h
	Contrôle continu	EPR									CC2 C2	50%	2H			
139UD06	Electronique plastique	UE	S9	24					3	33						
	Contrôle terminal	EPR									Ecrit E1	100%	2H	Ecrit E2	100,00%	2H
169UD25	Optoacoustique et applications	UE	S9	20					3	60						
	Contrôle continu	EPR									CC1 C1	100%	2H	Ecrit E2	100,00%	2H

**Condition validation du M2 :**

Moyenne générale supérieure ou égale à 10/20

Note minimum de 8/20 aux blocs.